

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【公表番号】特表2010-519705(P2010-519705A)

【公表日】平成22年6月3日(2010.6.3)

【年通号数】公開・登録公報2010-022

【出願番号】特願2009-550960(P2009-550960)

【国際特許分類】

H 05 B 33/04 (2006.01)

C 23 C 16/27 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

C 23 C 16/505 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/04

C 23 C 16/27

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

C 23 C 16/505

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月25日(2011.1.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水分又は酸素に弱い電子デバイスの保護のための非晶質ダイヤモンド状フィルム層を作成するプロセスであって：

シリコーン油からプラズマを形成する工程と；

該プラズマから非晶質ダイヤモンド状フィルム層を蒸着する工程と；

該非晶質ダイヤモンド状フィルム層と水分又は酸素に弱い電子デバイスとを組み合わせて、保護された電子デバイスを形成する工程とを含む、プロセス。

【請求項2】

有機電子デバイスと；

該有機電子デバイスに近接した非晶質ダイヤモンド状フィルム層とを含んでおり、該非晶質ダイヤモンド状フィルム層は、シロキサン部分を含み、1000オングストロームを超える厚さを有する、物品。

【請求項3】

電力供給される電極と対電極とを含む真空チャンバと；

該電力供給される電極とインピーダンス整合回路網を通じて電気的接続する高周波電源と；

該真空チャンバと流体連通するシリコーン油源とを含む、プラズマ蒸着装置。

【請求項4】

基板上に非晶質ダイヤモンド状フィルム層を作成するプロセスであって：

シリコーン油から高周波プラズマを形成する工程と；

プラズマから基板上に非晶質ダイヤモンド状フィルム層を蒸着する工程とを含むプロセ

ス。